「錯体化学」講義ノート テキストは「基礎無機化学 I・II」のテキスト 9 章

第 5•6 週

9-4 錯体の安定度 テキスト p.193

9-4-1 M"-L 間結合の強さ

- イ) 強さを決める要因・・・M^{**}について
- (1)イオン半径・・・小さい程、強い結合形成(イオン半径小、Lを引きつける能力大)
- (2)電気陰性度χ・・・大きい程、強い・・・

一般に M^{**}は電子受容体(Lewis 酸)

- (3) 電荷・・・大きい程、強い・・・
- (4)d 電子数····CFSE 大程、強い···

(1)~(3)は静電的要因

ロ)強さを決める要因・・・L について

配位原子小;負電荷大;χ小・・・主に静電的要因

9-4-2 溶液中の錯体の熱力学的安定度

溶液中・・・配位結合の強さ+溶媒効果

 $\downarrow \downarrow$

配位能力

錯形成(反応):溶媒分子との配位子置換反応に変化

相互作用:溶質-溶質、溶質-溶媒間

9-4-3 溶液中の錯体の安定度定数

表現一逐次安定度定数 consecutive or stepwise stability constant: K_1 、 K_2 、···、

上全--- overall stability constant: β_n

 $M + L \rightleftharpoons ML$ $K_1 = [ML]/[M][L] = \beta_1$

 $ML + L \rightleftharpoons ML_2$ $K_2 = [ML_2]/[ML][L], [ML_2]/[M][L]^2 = K_1K_2 = \beta_2$

 $ML_2 + L \rightleftarrows ML_3$ $K_3 = [ML_3]/[ML_2][L]$ 、 $[ML_3]/[M][L]^3 = K_1K_2K_3 = \beta_3$ (中略)

 $ML_{n-2} + L \rightleftharpoons ML_{n-1} \quad K_{n-1} = [ML_{n-1}]/[ML_{n-2}][L], [ML_{n-1}]/[M][L]^{n-1} = K_1K_2 \cdot \cdot \cdot K_{n-1} = \beta_{n-1}$ $ML_{n-1} + L \rightleftharpoons ML_n \quad K_n = [ML_n]/[ML_{n-1}][L], [ML_n][M][L]^n = K_1K_2 \cdot \cdot \cdot K_{n-1}K_n = \beta_n$ $= \prod_{i=1}^n K_i$

ただし、記号は M:金属イオン;L:配位子(電荷省略)

表9-5 実測値

一般に $K_1 > K_2 > K_3 > \cdots$ ^注

理由 i)次の L が入る可能性(配位座)減

ii)電子供与性の L の配位で M‴のχ減

注:錯体の構造変化等で逆転の例在り。例えば K3 < K4

 K_n

イ) Irving-Williams series

多数の錯体の β 。測定。結果、その大小は

Mn < Fe < Co < Ni < Cu > Zn

この順序はLの種類にかかわらず成立。Irving-Williams series(系列)と呼ぶ。

出身は南アフリカ-英国

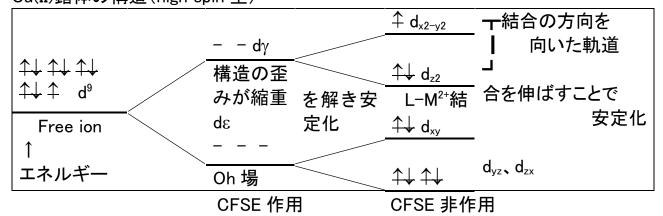
Oh 場の CFSE 予想: Ni(II)で最大(CFSE = 1.2); found では Cu(II)で最大

↓ CFSE 説明×

*K*₁~*K*₄で大きな値を示すことによる。

Ref. Jahn-Teller effect により構造安定化故

ロ) Jahn-Teller 効果・・・正八面体型構造の歪み Cu(II)錯体の構造(high spin 型)



① d⁸の場合、x、y、z 軸方向の L 反発は一様。

一方、②d⁹の場合、電子充填で d₂₂だけ L の反発強

 $\downarrow \downarrow$

z 軸方向の結合が伸びて、錯体を安定化=これを Jahn-Teller effect と・・・ 他の例 d⁴の Cr(II)錯体 etc.

電子配置:(d_{x2-y2})⁰(d_{z2})¹(d_{xy})¹(d_{yz})¹(d_{zx})¹

Lとの反発⇒z 軸の結合の伸びで安定化

ハ) 錯体と HSAB 則 テキスト p.163-165 参照 配位子 L の塩基性大⇒安定な錯体を形成

 $F^- > Cl^- > Br^- > l^-$

A) 以上の順で安定な錯体をつくり易い金属: クラス a 金属

⇒ Ahrland、Chatt & Davies の分類

M‴-L 相互作用・・・イオン性

また、

 $F^- < Cl^- < Br^- < l^-$

O²-〈S²-・・水に不溶の硫化物の沈殿生成

B) これらの順で安定な錯体をつくり易い金属:クラス b 金属 Cu 族、Zn 族、Sn、Pb、Pt

M/*-L 相互作用···共有結合性

- C) HSAB 則
- C-1)クラス a 金属:O、N を含む配位子や F⁻と好んで結合⇒Hard acid
- C-2) クラス b 金属:S、P を含む配位子や I と好んで結合⇒Soft acid
- C-3) Hard acid は分極されにくい。・・・イオン結合容易
- C-4) Soft acid は非常に分極されやすい。・・・共有結合容易
- C-5) Hard 同士、soft 同士の組み合わせ⇒一般に、最も安定な錯体を生成 以上の考え方: Pearson によって提案

『memo』 結合異性について Ref. 9-2-2

Ru(III)-NCS-結合生成···hard acid-N 結合

Ru(II)-SCN-結合生成・・・soft acid-S 結合

HSAB 則は元素に固有な性質ではない?

9-4-4 錯体の組成決定・・・実験テキスト「大学実習 分析化学」p.212 参照 M^mとしがどんな割合で結合するか・・・錯体の基本的な情報

例えば、 $AI^{3+} + 8-EFロキシキノン(HQ) \rightarrow ?$

Al^{III}Q₃組成の錯体生成。HQ は N.O 二座配位子

組成決定法の代表例→連続変化法 Continuous variation method Lモル比法 Molar ratio method

主に吸光光度法を利用

イオン交換法 etc.

イ)連続変化法

Job 法とも。柴田雄次らが I₂ + I ⇄ I₃ の反応で創案・・・ 錯生成平衡

*m*M + *n*L ⇄ M*m*L*n* (付 10)(電荷は省略)

平衡後の濃度:a - mx b - nx x

ここで、a、b: M と L のそれぞれの初濃度: x: 生成錯体の濃度(分析値)である。 反応(付10)の平衡定数は

$$K = x/\{(a - mx)^m(b - nx)^n\}$$
 (付11)

実験は a + b = c(-c)で行う。c の式を式(付11)に代入し整理すると

 $x = K(a - mx)^{m}(c - a - nx)^{n}$ (付12)

M の濃度 a を a \sim c で変化させたとき、錯体の濃度 x の max は dx/da = 0 の条件 で求まる。式(付12)を a で微分。その後 c = a + b を再代入して整理

 $dx/da = K(a - mx)^{m-1}(b - nx)^{n-1} \times [(mb - na) - \{m^2(b - nx) + n^2(a - mx)\}(dx/da)]$

(付13)

条件 dx/da = 0 を代入して式(付13)を解くと、ma = mb を得る。それで

n/m = b/a(付14)

が成立。従って、x vs. a/c プロットのピークから錯体の組成を決定できる。

「大学実習 分析化学」の図 2・40 の右図参照

a/c = 0.5(ピーク位置)より M:L(= a:b) = 1:1

= 0.33 より M:L = 1:2

= 0.25 より M:L = 1:3 のようになる。

ロ)モル比法

例として、1:1 錯体の生成平衡

 $M + L \rightleftharpoons ML$

(付15)(電荷は省略)

を考える。

L可視部に光吸収がある錯体

平衡での濃度は

 $[M]_+ = [M] + [ML]$

(付16a)

 $[L]_{t} = [L] + [ML]$

(付16b)

ここで、「M」、「L」は、それぞれ M、L の全濃度。他は平衡濃度である。

また、吸光光度法によると

 $A = \varepsilon_{ML}[ML] \times 1$

(付17) (固定波長で)

A: 固定波長での ML の吸光度; ε_{M:L}: 錯体のモル吸光係数(L mol⁻¹cm⁻³ 単位); [ML]: 錯体の平衡濃度(mol L⁻¹)。 1 は測定セルの光路長の 1 cm を意味。 平衡定 数 *K*を

K = [ML]/[M][L] (付 18)

と定義し、「ML] = xとすれば

 $x = K([M]_t - x)([L]_t - x)$

整理して、

 $Kx^2 - \{1 + K(\lceil M \rceil_t + \lceil L \rceil_t)\}_X - K\lceil M \rceil_t \lceil L \rceil_t = 0$ (付 19)

二次方程式の解の公式を適用し、xを求める(平方根は \oplus 項を採用。x>0故)。 さらに、式(付17)から $A = \varepsilon_{MI} \times \mathcal{O}$ 関係を得る。

ɛм 値を、別途実験等から求めておく。「M], を固定し「L], を変化させ(逆の操作条 件も可)Aを測定し、A vs. [L],/[M],をプロットし、錯体の組成を決定する。

「大学実習 分析化学」の図 2・40 の左図参照

Kの値を変え、A vs. [L],/[M], plot を再現すると?

『memo』 A = ε_M x の関係を用いて、実測の A vs. [L]₊/[M]₊プロットを curve-fitting すると、最適な組み合わせの K、εμ 値が得られる。・・・K 推算法